УДК 666.3-13666.7-121621.762.34621.762.52

ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЕ ПЛАЗМЕННОЕ СПЕКАНИЕ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ Si₂N₂O

© 2022 г. Л. С. Алексеева^{1, *}, П. В. Андреев¹, П. Д. Дрожилкин¹, М. С. Болдин¹, К. Е. Сметанина¹, А. А. Мурашов¹, К. О. Каразанов¹, Г. В. Щербак¹

¹Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, пр. Гагарина, 23, Нижний Новгород, 603022 Россия *e-mail: golovkina_lyudmila@mail.ru Поступила в редакцию 29.12.2021 г. После доработки 05.04.2022 г.

Принята к публикации 08.04.2022 г.

Изготовлены порошковые смеси на основе нано-Si₃N₄ и оксидов иттрия и алюминия. Методом электроимпульсного плазменного спекания при давлении 80 МПа и скорости нагрева 50°С/мин получены образцы керамики с относительной плотностью 95–96%. Микроструктура образцов представляет собой зерна Si₂N₂O размером ~0.7 мкм с распределенной между ними аморфной оксидной фазой. Наибольшая твердость (13.3 ГПа) наблюдалась у образца с мольным соотношением оксидов Y_2O_3 и Al₂O₃ (2 : 1), полученного при температуре спекания 1770°С.

Ключевые слова: оксинитрид кремния, электроимпульсное плазменное спекание, керамика, плотность

DOI: 10.31857/S0002337X22070028

введение

В последние годы популярность набирают керамические материалы на основе ковалентных кремниевых соединений в качестве термоустойчивых конструкционных материалов [1]. В частности, оксинитрид кремния (Si_2N_2O) и сиалоны (Si-Al-O-N) благодаря высокой стойкости к тепловому удару, жаропрочности, коррозионной стойкости, стойкости к окислению, износостойкости и низкому коэффициенту температурного расширения являются перспективными материалами для высокоответственных изделий, работающих при повышенных температурах [2–4].

Получение керамики из чистого оксинитрида кремния традиционным спеканием затруднено, так как в исходных порошках Si_2N_2O содержится много примесных фаз, таких как Si_3N_4 , SiO_2 , остаточный кремний и т.д. [5]. В связи с этим в настоящее время предлагаются новые способы получения оксинитридных керамик [5, 6]. Известны способы получения плотной керамики из оксинитрида кремния методом горячего прессования порошковых смесей Si_3N_4 и SiO_2 с различными добавками (Y_2O_3 , Al_2O_3 , MgO, Li_2O и др.) [7–9].

В последние годы популярностью исследователей пользуется технология электроимпульсного ("искрового") плазменного спекания (ЭИПС) [10], представляющая собой способ высокоскоростного горячего прессования. При ЭИПС спекание порошков, предварительно помещенных в графитовую пресс-форму, происходит в вакууме или в инертной среде в условиях приложения одноосного давления. Нагрев (до 750°С/мин) создается постоянным током, протекающим между пуансонами в импульсном режиме. Высокие скорости спекания обеспечивают незначительный рост зерен, что позволяет создавать ультрамелкозернистые керамики, для чего используют исходное сырье в виде нанопорошков [11].

Ранее методом ЭИПС из нанопорошковой смеси на основе нитрида кремния с добавкой Y_2O_3 – Al_2O_3 нами была получена керамика Si_2N_2O [12]. Был сделан вывод, что аморфный нанопорошок (<15 нм) Si_3N_4 в процессе изготовления шихтовых смесей взаимодействует с атмосферой и адсорбирует на своей поверхности кислород. В процессе ЭИПС происходит взаимодействие наночастиц Si_3N_4 с кислородом, которое обеспечивает условия для образования и роста зерен оксинитрида кремния, а растворение Si_3N_4 при жидкофазном спекании в оксидной спекающей добавке могло привести к появлению твердого раствора замещения, изоструктурного Si_2N_2O , называемого O'-сиалон [13].

Цель настоящей работы — получение и изучение механизма ЭИПС керамики Si_2N_2O из смеси, синтезированной методом Печини из нанопо-

рошка Si_3N_4 и нитратов иттрия и алюминия в качестве прекурсоров спекающих добавок состава $Al_2O_3-Y_2O_3$ в количестве не более 5 мас. % (в пересчете на оксидную фазу). Соотношение нитратов иттрия и алюминия было выбрано из расчета существующих стехиометрических фаз, характерных для системы $Al_2O_3-Y_2O_3$, чтобы проследить их возможное влияние на процесс спекания и фазовый состав.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Объектами исследования являлись смеси на основе Si_3N_4 с добавками 5 мас. % оксидов иттрия и алюминия в различных стехиометрических соотношениях, соответствующих иттрий-алюминиевому перовскиту YAlO₃, иттрий-алюминиевому оксиду в моноклинной модификации Y₄Al₂O₉ и иттрий-алюминиевому гранату Y₃Al₅O₁₂. В качестве исходного материала использовался порошок Si₃N₄ (производитель ABCR Gmbh, Германия) с размером частиц 15–30 нм и содержанием не менее 98.5 мас. % Si₃N₄.

Керамику получали методом ЭИПС на установке Dr. Sinter model-625 в вакууме. Порошки помещали в графитовую пресс-форму внутренним диаметром 10.8 мм и нагревали за счет пропускания миллисекундных импульсов электрического тока большой мощности (до 3 кА). ЭИПС проводили при давлении 80 МПа до окончания процесса усадки. Давление к образцу прикладывалось одновременно с началом нагрева. Скорость нагрева до 600°С составляла 100°С/мин, нагрев до температуры окончания усадки проводили со скоростью 50°С/мин. Изотермическая выдержка при температуре спекания не применялась. Температура в процессе спекания измерялась оптическим пирометром, сфокусированным на поверхности пресс-формы. Охлаждение образцов проводилось в свободном режиме, вместе с установкой. Для удаления с поверхности образца остатков графита их отжигали в печи ЭКПС-10 на воздухе при температуре 750°С (2 ч).

В процессе ЭИПС с помощью дилатометра установки Dr. Sinter model SPS-625 фиксировалась зависимость усадки порошков от температуры нагрева L(t), которая пересчитывалась в температурную зависимость уплотнения $\rho/\rho_{th}(t)$ в соответствии с процедурой, описанной в работе [14].

Плотность полученных керамик (ρ) измеряли методом гидростатического взвешивания в дистиллированной воде на весах Sartorius CPA 225D. Теоретическая плотность оценивалась из соотношения Si₂N₂O : Y_xAl_yO_z = 95 : 5 мас. %. При расчете теоретической плотности (ρ_{th}) керамики плотность Si₂N₂O принималась равной 2.81, YAlO₃ – 5.51, Y₄Al₂O₉ – 4.41, Y₃Al₅O₁₂ – 4.55 г/см³.

Рентгенофазовый анализ (**РФА**) образцов проводили на дифрактометре Shimadzu LabX XRD-7000 (излучение Cu K_{α} , $\lambda = 1.54$ Å). Размер областей когерентного рассеяния (**ОКР**) рассчитывали по методу Галдера–Вагнера [15]. Микроструктуру керамических образцов изучали с использованием растрового электронного микроскопа (**РЭМ**) JEOL JSM-6490.

Твердость по Виккерсу (H_v) определяли с помощью микротвердомера Qness 60A+ при нагрузке 20 Н. Минимальный коэффициент трещиностойкости (K_{lc}) определяли методом Палмквиста на основе измерения максимальных длин трещин от углов отпечатка индентора. При расчете K_{lc} величина модуля упругости принималась равной 240 ГПа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для получения смесей составов 95 мас. % Si₃N₄ + +5 мас. % (Al₂O₃ + Y₂O₃) к смеси растворов нитратов иттрия (Y(NO₃)₃ · 6H₂O, "х. ч.") и алюминия $(Al(NO_3)_3 \cdot 9H_2O, "ч.")$, взятых в стехиометрических соотношениях $YAlO_3$ (серия 1), $Y_4Al_2O_9$ (серия 2) и Y₃Al₅O₁₂ (серия 3), добавляли раствор лимонной кислоты ($C_6H_8O_7 \cdot H_2O$, "х. ч.") и перемепри 80°С. Мольное соотношение шивали лимонной кислоты к суммарному содержанию нитрат-ионов составляло 1:1. К полученной смеси добавляли нанопорошок Si₃N₄ в количестве 95 мас. % (в пересчете на состав Si_3N_4 -Al₂O₃-Y₂O₃) и высушивали при постоянном перемешивании при температуре 120°С до состояния густого геля. Полученный гель отжигали при температуре 300°С в течение 1 ч.

Результаты РФА порошковой смеси показывают, что пики, соответствующие оксидной фазе и Si_3N_4 , отсутствуют, что позволяет сделать вывод об их аморфном состоянии.

В процессе ЭИПС были получены образцы керамики серий *1*, *2*, *3* с плотностью 94.8% (2.73 г/см³), 95.5% (2.73 г/см³) и 96.4% (2.76 г/см³) соответственно. Образцы не имели видимых макродефектов.

Как видно из представленных на рис. 1 диаграмм ЭИПС "время (τ , с)-температура (t, °С)приложенное давление (P, МПа)-давление вакуума (Vac, Па)", при нагреве порошков наблюдается резкое снижение уровня вакуума, что свидетельствует о протекании химических реакций и диссоциации с поверхности образцов элементов, входящих в состав спекаемых керамик. Для образца серии I наблюдается резкое снижение уровня вакуума до величины, близкой к нулю в интервале температур 500-800°С (время процесса $\tau = 300$ -600 с), и затем незначительное снижение уровня вакуума в интервале температур 1100-1200°С ($\tau = = 1000$ -1080 с) (рис. 1а). Первый минимум связан



Рис. 1. Диаграммы зависимости температуры (t), давления пресса (P) и уровня вакуума (Vac) от времени процесса ЭИПС образцов керамики серий 1 (a), 2 (б) и 3 (в).

с разложением промежуточных продуктов синтеза оксидной добавки. Аналогичный двухстадийный характер уменьшения уровня вакуума наблюдается при ЭИПС образцов серий 2 и 3, но температурные интервалы протекания реакций

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ том 58 № 7 2022



Рис. 2. Зависимости уплотнения образцов керамики от температуры нагрева в процессе ЭИПС.

диссоциации смещены в область бо́льших температур нагрева, а интенсивность снижения вакуума в области низкотемпературного отжига оказывается меньше, чем для образца серии *1*.

Анализ представленных на рис. 2 кривых уплотнения $\rho/\rho_{th}(t)$ показывает, что кинетика спекания схожа для всех образцов. Зависимости $\rho/\rho_{th}(t)$ имеют немонотонный характер с ярко выраженной стадией скачкообразной ("лавинообразной") усадки при пониженных температурах нагрева. Стадия интенсивной усадки нанопорошков начинается при температурах ~1200, 1240 и 1350°С для образцов серий 1, 2 и 3, а завершается при температурах 1755, 1730 и 1610°С соответственно. Предельная величина уплотнения для всех образцов составляет 0.95-0.96, но достигается при различных температурах. Для образцов серий 1 и 2 температуры, при которых достигается максимальное уплотнение, составляют примерно 1740 и 1770°С соответственно. Керамика серии 3 достигает максимального уплотнения при температуре 1640°С. Таким образом, скорость уплотнения керамического образца серии 3 является самой высокой, а температура спекания – самой низкой.

По данным РФА, состав керамики представлен преимущественно кристаллической фазой Si_2N_2O (PDF \mathbb{N} 01-075-5608) и фазой β -Si₃N₄ (PDF \mathbb{N} 01-071-0623) (рис. 3). Содержание фазы β -Si₃N₄ по оценкам, выполненным методом корундовых чисел, не превышает 2% в образцах серий *1* и *3* и 5% в керамике серии *2*. Пики фазы β -Si₃N₄ имеют небольшую интенсивность и уширены, что говорит о малом размере OKP. Параметры элементарной ячейки фазы Si₂N₂O имеют равные в пределах погрешности значения около a = 8.87(1) Å, b = 5.49(1) Å, c = 4.85(1) Å для всех образцов, что соответствует Si₂N₂O по базе дан-



Рис. 3. Дифрактограммы образцов керамики серий 1-3.

ных ICSD (№ 34025) и заметно ниже характерных параметров для О'-сиалона, имеющего ту же кристаллическую модификацию.

По нашему мнению, очень быстрая усадка порошковой смеси на начальной стадии ЭИПС может быть связана с лавинообразной кристаллизацией оксинитрида кремния из наноструктурированного нитрида кремния с адсорбированным на поверхности частиц кислородом. Различие температур, при которых этот процесс запускается, вероятно, связано с составом спекающей оксидной добавки. Аналогичные различия характерны и для спекания Si₃N₄ [16].

Параметры элементарной ячейки фазы β -Si₃N₄ установить не удалось ввиду малости ее объемной доли и размеров OKP, поэтому не исключено, что в ней содержатся примесные катионы Al³⁺ и Y³⁺. В этом случае, по нашему мнению, корректнее говорить о фазе β -сиалона, изоморфной β -Si₃N₄. Дифракционные пики, соответствующие оксидам, не выявлены, что позволяет говорить об их аморфном состоянии. Размеры OKP для всех образцов составляют 0.71–0.73 мкм.

Микроструктура спеченных образцов состоит из темно-серых зерен Si_2N_2O размером менее 1 мкм (рис. 4), что коррелирует с оценкой ОКР. Между зернами Si_2N_2O располагаются светлые частицы оксидов размером менее 0.5 мкм. В микроструктуре наблюдается остаточная нано- и микропористость; средний размер пор не превышает 0.3 мкм. В качестве примера на рис. 4в единичные крупные поры указаны желтыми стрелками.

Микротвердость H_v образцов серий 1, 2, 3 составила 12.2 ± 0.7, 13.3 ± 0.5, 10.9 ± 0.6 ГПа соответственно. Минимальный коэффициент трещиностойкости K_{Ic} , рассчитанный по длине максимальной радиальной трещины, для образцов данных серий составил 1.5 ± 0.1, 1.6 ± 0.2 и 1.2 ± ± 0.1 МПа м^{1/2} соответственно. Низкие значения коэффициента трещиностойкости обусловлены,



Рис. 4. РЭМ-изображения поверхности образцов керамики серий 1(a), 2(6), 3(B).

очевидно, наличием нано- и микропор в структуре, которые могут являться областями зарождения микротрещин при нагружении.

Для анализа механизмов высокоскоростного спекания использовали две взаимно дополняющих друг друга модели: модель Янга–Катлера [17]





Рис. 5. Иллюстрация к расчету энергии активации ЭИПС в рамках модели Янга–Катлера (а), в рамках модели диффузного растворения пор (б).

и модель диффузионного растворения пор вблизи границ зерен в мелкозернистых материалах [14].

Модель Янга-Катлера описывает начальную стадию неизотермического спекания сферических частиц в условиях одновременного протекания процессов объемной и зернограничной диффузии, а также вязкого течения материала [17]. В соответствии с [17], угол наклона зависимости усадки от температуры в координатах $\ln(T\partial\varepsilon/\partial T) - T_m/T$ соответствует эффективной энергии активации спекания mQ_{s1} , где m – коэффициент, зависящий от доминирующего механизма спекания (m = 1/3 для случая зернограничной диффузии, m = 1 для вязкого течения), T_m – температура плавления ($T_m = 1970$ K).

Зависимости $\ln(T\partial \varepsilon/\partial T) - T_m/T$ на стадии интенсивной усадки для исследуемых образцов имеют традиционный двухстадийный характер (рис. 5а). Анализ полученных результатов показывает, что эффективная энергия активации ЭИПС (mQ_{s1}) на стадии интенсивной усадки составляет ~ $(7.7-9.5)kT_m$. В области высоких температур спекания угол наклона зависимости $\ln(T\partial \epsilon/\partial T) - T_m/T$ становится отрицательным (рис. 5а) и для анализа кривых уплотнения корректнее использовать модель диффузионного растворения пор [17].

В рамках модели диффузионного растворения пор энергия активации спекания Q_{s2} может быть определена по углу наклона зависимости ln(ln($\alpha\rho/\rho_{th}/(1-\rho/\rho_{th})$)- T_m/T , где $\alpha = 0.5-0.62$ – коэффициент уплотнения прессовки, пропорциональный насыпной плотности порошков (рис. 5б). Проведенный анализ показал, что энергия активации Q_{s2} для образцов серий 1-3 составляет ~ $(7.7-10.4)kT_m$.

Таким образом, значения эффективной энергии активации mQ_{s1} , рассчитанной в рамках модели Янга—Катлера [17], и значения энергии активации Q_{s2} , рассчитанной в рамках модели диффузионного растворения пор, оказываются близки друг к другу. Это означает, что величина коэффициента *m* близка к единице ($m \sim 1$), что соответствует случаю вязкого течения материала в условиях горячего прессования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методом Печини получены порошковые смеси на основе нанесенных на поверхность частиц Si₃N₄ оксидов иттрия и алюминия в роли спекающей добавки состава $Al_2O_3-Y_2O_3$ в количестве 5 мас. % (в пересчете на оксидную фазу). Соотношение ионов Y³⁺ и Al³⁺ выбрано из расчета существующих стехиометрических фаз иттрий-алюминиевого перовскита YAlO₃, иттрий-алюминиевого оксида в моноклинной модификации Y₄Al₂O₉ и иттрий-алюминиевоого граната Y₃Al₅O₁₂.

Методом ЭИПС получены образцы керамики, состоящие из кристаллических частиц Si_2N_2O размером около 0.7 мкм. Наибольшая твердость (13.3 ГПа) наблюдалась у образца с добавкой оксидов иттрия и алюминия в мольном соотношении Y^{3+} : $Al^{3+} = 2: 1$, спеченного при температуре 1770°С.

С использованием модели Янга-Катлера и модели диффузионного растворения пор показано, что основным механизмом уплотнения порошков на стадии интенсивной усадки является процесс вязкого течения материала в условиях горячего прессования.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта президента РФ для молодых российских ученых — кандидатов наук № МК-4584.2021.1.3.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Wang Y., Hou Q., Tian L. et al.* Effect of in situ Synthesis of Si₂N₂O on Microstructure and the Mechanical Properties of Fused Quartz Ceramic // Ceram. Int. 2020. V. 46. № 7. P. 8725–8729. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.12.111
- Riley F.L. Silicon Nitride and Related Materials // J. Am. Ceram. Soc. 2000. V. 83. P. 245–265. https://doi.org/10.1111/J.1151-2916.2000.TB01182.X
- 3. *Ohashi M., Kanzaki S., Tabata H.* Processing, Mechanical Properties, and Oxidation Behavior of Silicon Oxynitride Ceramics // J. Am. Ceram. Soc. 1991. V. 74. P. 109–114.
 - https://doi.org/10.1016/0272-8842(95)00136-0
- Radwan M., Kashiwagi T., Miyamoto Y. New Synthesis Route for Si₂N₂O Ceramics Based on Desert Sand // J. Eur. Ceram. Soc. 2003. V. 23. P. 2337–2341. https://doi.org/10.1016/S0955-2219(03)00040-2
- Inagaki Y., Ohji T., Kanzaki S., Shigegaki Y. Fracture Energy of an Aligned Porous Silicon Nitride // J. Am. Ceram. Soc. 2000. V. 83. P. 1807–1809. https://doi.org/10.1111/J.1151-2916.2000.TB01468.X
- Kawai C., Yamakawa A. Effect of Porosity and Microstructure on the Strength of Si₃N₄: Designed Microstructure for High Strength, High Thermal Shock Resistance, and Facile Machining // J. Am. Ceram. Soc. 1997. V. 80. P. 2705–2708. https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1997.tb03179.x
- Billy M., Boch P., Dumazeau C. et al. Preparation and Properties of New Silicon Oxynitride Based Ceramics // Ceram. Int. 1981. V. 7. № 1. P. 13–18. https://doi.org/10.1016/0272-8842(81)90033-X
- 8. Fruhstorfer J., Kerber F., Weigelt C. et al. Activated Reaction Synthesis of Silicon Oxynitride from Silica and Silicon Nitride // Ceram. Int. 2018. V. 44. № 7. P. 8467–8475.

https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.02.044

 Tong Q., Wang J., Li Z., Zhou Y. Low-Temperature Synthesis/Densification and Properties of Si₂N₂O Prepared with Li₂O Additive // J. Eur. Ceram. Soc. 2007. V. 27. № 16. P. 4767–4772. https://doi.org/10.1016/i.jeurceramsoc.2007.04.004

- Tokita M. Pulse Electric Current Synthesis and Processing of Materials // Development of Advanced Spark Plasma Sintering (SPS) Systems and Its Industrial Applications / Eds. Munir Z.A. et al. 2006. New Jersev: Wiley. P. 314.
- Nishimura T., Xu X., Kimoto K., Hirosaki N., Tanaka H. Fabrication of Silicon Nitride Nanoceramics – Powder Preparation and Sintering: A Review // Sci. Technol. Adv. Mater. 2007. V. 8. P. 635–643. https://doi.org/10.1016/j.stam.2007.08.006
- Andreev P., Rostokina E., Alekseeva L. et al. Spark Plasma Sintering of Si₃N₄-YAG Nanocomposite // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2021. V. 1014. P. 1–4. https://doi.org/10.1088/1757-899X/1014/1/012002
- Trigg M.B., Jack K.H. The fabrication of O'-Sialon Ceramics by Pressureless Sintering // J. Mater. Sci. 1988. V. 23. P. 481–487. https://doi.org/10.1007/bf01174673
- 14. Чувильдеев В.Н., Болдин М.С., Дятлова Я.Г. и др. Сравнительное исследование горячего прессования и высокоскоростного электроимпульсного плазменного спекания порошков Al₂O₃/ZrO₂/Ti(C,N) // Журн. неорган. химии. 2015. Т. 60. № 8. С. 1088–1094.
- Halder N.C., Wagner C.N.J. Separation of Particle Size and Lattice Strain in Integral Breadth Measurements // Acta Crystallogr. 1966. V. 20. P. 312–313. https://doi.org/10.1107/S0365110X66000628
- 16. *Petzow G., Herrmann M.* Silicon Nitride Ceramics // High Performance Non-Oxide Ceramics II. Structure and Bonding / Ed. Jansen M. V. 102. Berlin: Springer, 2002.

https://doi.org/10.1007/3-540-45623-6_2

17. *Young W.S., Cutler I.B.* Initial Sintering with Constant Rates of Heating // J. Am. Ceram. Soc. 1970. V. 53. № 12. P. 659–663. https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1970.tb12036.x